

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年:2012年~2016年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
 特殊ガス企画委員会
 単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2012年 (平成24年)		2013年 (平成25年)		2014年 (平成26年)		2015年 (平成27年)		2016年 (平成28年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルシン	AsH3	13,300	81%	10,800	81%	9,800	91%	11,800	120%	11,200	95%
2	ジボラン	B2H6	390	72%	680	174%	390	57%	360	92%	450	125%
3	三塩化ホウ素	BCl3	105,400	87%	102,900	98%	126,700	123%	145,800	100%	146,300	100%
4	四フッ化炭素	CF4	484,300	98%	500,600	103%	565,200	113%	535,300	95%	631,800	118%
5	三フッ化メタン	CHF3	78,300	98%	82,900	106%	84,900	102%	97,200	114%	93,500	96%
6	六フッ化エタン	C2F6	206,300	91%	175,500	85%	131,800	75%	169,500	129%	178,400	105%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	51,800	107%	56,100	108%	65,000	116%	51,500	79%	83,700	163%
8	塩素	Cl2	255,800	74%	274,000	107%	307,100	112%	352,000	115%	356,200	101%
9	ゲルマニウム	GeH4	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%
10	臭化水素	HBr	95,000	89%	91,600	96%	125,400	137%	157,300	125%	164,400	105%
11	アンモニア	NH3	2,842,200	114%	2,919,000	103%	3,442,600	118%	3,697,000	107%	3,522,700	95%
12	三フッ化窒素	NF3	1,588,800	97%	1,694,200	107%	1,717,600	101%	1,817,400	106%	1,634,000	90%
13	一酸化二窒素	N2O	739,500	125%	951,300	129%	992,500	104%	1,129,200	114%	1,219,500	108%
14	ホスフィン	PH3	11,500	93%	8,000	70%	8,300	104%	6,700	81%	6,900	103%
15	モノシラン	SiH4	323,500	60%	373,700	116%	424,700	114%	398,200	94%	316,400	79%
16	ジクロロシラン	SiH2Cl2	166,100	96%	256,300	154%	172,800	67%	239,300	138%	187,600	78%
17	四フッ化ケイ素	SiF4	6,000	105%	5,400	90%	5,400	100%	5,400	100%	6,500	120%
18	TEOS	(C2H5O)4Si	399,600	98%	380,800	95%	421,900	111%	441,800	105%	490,500	111%
19	六フッ化硫黄	SF6	243,000	91%	240,000	99%	211,000	88%	208,000	99%	210,000	101%
20	六フッ化タンダステン	WF6	100,000	97%	95,000	95%	105,000	111%	115,000	110%	121,000	105%
21	有機金属		3,040	109%	2,250	74%	2,090	93%	2,510	120%	2,100	84%
22	その他ガス	H2Se BF3、Si2H6 SiHCl3等										
年間需要金額(単位:億円)			534	87%	522	98%	526	101%	573	109%	544	95%

※2015年のC2F6の需要量に誤りがありましたので修正いたしました。